

[兵庫県立大学大学院工学研究科長・工学部長]

1 氏 名 ふじさわ ひろのり

藤 澤 浩 訓

2 生年月日 昭和46年12月28日(52歳)

3 略 歴

平成 6年 3月 京都大学工学部電子工学科卒業
平成 8年 3月 京都大学大学院工学研究科電子工学専攻修了
平成 8年 4月 姫路工業大学工学部助手
平成14年 4月 姫路工業大学大学院工学研究科助手
平成16年 4月 兵庫県立大学大学院工学研究科助手
平成19年 4月 兵庫県立大学大学院工学研究科助教
平成20年10月 兵庫県立大学大学院工学研究科准教授
平成30年 4月 兵庫県立大学大学院工学研究科教授, 工学研究科長補佐
令和 2年 4月 兵庫県立大学大学院工学副部長
令和 4年 4月 兵庫県立大学大学院工学研究科長兼工学部長 [現在に至る]

4 受賞歴 平成20年12月 Award for Encouragement of Research in Materials
Science (Dec. 13, 2008), The IUMRS International Conference in Asia 2008 (IUMRS-ICA 2008).

平成26年 4月 APEX/JJAP 編集貢献賞 (応用物理学会)

平成31年 3月 APEX/JJAP 編集貢献賞 (応用物理学会)

5 学 位 平成16年 1月 博士(工学) (京都大学)

6 専 攻 電子工学(強誘電体薄膜)

7 研究業績

著 書

(1) *Nanoscale Phenomena in Ferroelectric Thin Films*, Chap. IX, Nanoscale Investigation of MOCVD Pb(Zr,Ti)O₃ Thin Films Using Scanning Probe Microscopy, (共著), Kluwer Academic Publishers 2003).

他1報(解説・総説など4報)

論 文 (共著, 全て査読あり)

(1) Composition control and introduction of an Fe₂O₃ seed layer in metalorganic chemical vapor deposition of epitaxial BiFeO₃ thin films, *Jpn. J. Appl. Phys.* 58, 041003 (2019).

(2) Atomic structure stabilization in BiFeO₃ thin film by Mn doping, *Jpn. J. Appl. Phys.* 59 (2020) 010602.

(3) X-ray absorption and photoemission spectroscopy of bulk insulating materials using graphene, *J. Appl. Phys.*, 128 (2020) 15304.

(4) Enhancement of photovoltage by electronic structure evolution in multiferroic Mn-doped BiFeO₃ thin films, *Scientific Reports*, 10 (2020) 15108.

(5) Nonvolatile operation of vertical ferroelectric gate-all-around nanowire transistors, *Jpn. J. Appl. Phys.*, 60 (2021) SFFB10.

(6) Crystallization of (Hf, Zr)O₂ thin films via non-heating process and their application to ferroelectric-gate thin film transistors, *Jpn. J. Appl. Phys.*, 62, SM1019 (2023).

他153報